

2006 年度プロセス設計発表スケジュール

2006 年 7 月 7 日 (金)

京都大学桂キャンパス 9:00-17:00 電気系大講義室(A1-001)

時 間	発 表 者	タ イ ト ル
-----	-------	---------

(司会：鈴木先生)

9:00- 9:20	4 青谷幸司, 鈴木優貴, 東直樹	ベンゼンのアルキル化によるエチルベンゼンの製造
9:20- 9:40	4 池田道治, 板倉啓, 宮本敬子	ベンゼンの直接酸化によるフェノールの製造プロセス
9:40-10:00	3 水野邦彦, 藤本航平, 山本剛紀	家庭用PEFCコージェネレーションシステム
10:00-10:20	3 伊藤敬文, 稲垣達也, 城市致	ポリエチレンテレフタレートケミカルリサイクル

(休憩 10:20 - 10:30)

(司会：神田先生)

10:30-10:50	2 市川裕介, 片山利彦, 吉田篤史	ATR 法を用いたメタノールからの水素製造法
10:50-11:10	2 足立裕文, 吉田新太	メタノールからのオレフィン製造プロセス
11:10-11:30	1 平田琢也, 森下聡, 瀬崎惇浩	熱化学水素製造法 IS プロセス
11:30-11:50	1 鈴木彬, 松岡佑樹	アンモニア合成プロセス

(昼食 11:50 - 13:10)

(司会：青木先生 (前半3件), 殿村先生 (後半3件))

13:10-13:30	8 稲田淳史, Khoo Teng Hong	ギ酸メチルの製造
13:30-13:50	8 池田頭一, 北田純一, 長谷川祐介	アンモニアの合成
13:50-14:10	8 後藤俊, 北島亮平	バイオディーゼル製造における超臨界メタノール法の検討 ～一段階法と二段階法～
14:10-14:30	7 川島康人, 久保田将人, 田坂謙一	エチレン直酸法による酢酸製造プロセス
14:30-14:50	7 岩井祐樹, 中田賢志, 前中香織	Ru 系触媒を用いたアンモニア合成プロセス
14:50-15:10	9 亀田一平, 杉本壮馬	ACH 法による MMA の製造プロセス

(休憩 15:10 - 15:20)

(司会：瀧先生)

15:20-15:40	6 梶井昭佳, 吉武惟一	アセトンとベンゼンを原料としたビスフェノールAの製造
15:40-16:00	6 北野大作, 鶴直樹, 星野哲郎	CuBi/MgO-SiO ₂ 触媒下でのレッププロセスによる 1,4-Butynediol の製造プロセス
16:00-16:20	5 白井聖, 永水愛子, 新居辰彦	超臨界二酸化炭素によるジメチルカーボネートのワンポット合成
16:20-16:40	5 田中良敬, 真野涼平	テトラ法による過酸化水素の製造プロセス

(司会：加納先生)

16:40-17:00	鈴木先生 (東洋エンジニアリング) による講評
-------------	-------------------------

- * 発表時間 **14分**, 質疑応答 **6分**.
- * 液晶プロジェクターを使用し, スクリーンは1つだけとする.
- * 同一のセッションで発表するグループは, 事前に調整して1台のパソコンを利用すること.
- * 他のグループの発表も必ず聞くこと.

- * レポートは回覧・製本するので, 必ずページ番号を入れること.
- * レポートの表紙にはタイトルと氏名の他に, キーワードを日本語と英語でそれぞれ5個ずつ書くこと.
- * レポートは表紙を貼付した封筒(角2サイズ・みなし)に入れて, **7月14日(金)17時**までにPSE研スタッフ室 (A4-122) に提出すること.